PAT-NO:

JP02000063682A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000063682 A

TITLE:

RESIN COMPOSITION CONTAINING RARE EARTH

COMPLEX, AND

MOLDED ITEM

PUBN-DATE:

WADA, YUJI

February 29, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HASEGAWA, YASUCHIKA

N/A

SOGABE, KENSAKU

N/A N/A

YANAGIDA, SHOZO

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEW JAPAN CHEM CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP10238973

APPL-DATE:

August 25, 1998

INT-CL (IPC): C08L101/00, C08K005/00, C08L023/00, C08L025/00,

C08L033/00

, C08L063/00 , C09K011/06

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resin compsn. excellent in luminous characteristics by incorporating a rare earth complex into a polymer matrix.

SOLUTION: This compsn. comprises 0.001-20 wt.% rare earth complex and 99.

999-80 wt.% polymer (e.g. a polymethacrylate). This compsn. in an amt. of 100 pts.wt. can be mixed with 0-2,000 pts.wt. polar solvent (e.g. dimethyl sulfoxide). The rare earth complexes represented by formulas I, II, and III are prepd. by mixing the corresponding ligands with at least one rare earth metal compd. selected from rare earth metal oxides, rare earth metal hydroxides, rare earth metal alkoxides, rare earth metal amides, and rare earth metal salts, In the formulas, M is a rare earth atom; Rf1 to Rf3 are each a hydrogen-free 1-22C aliph. group, an arom. group or the like; X1 and X2 are each a group-IVA atom, a group VA atom (except nitrogen) or the like; X3 is a group-IVA atom (except carbon), a group-VA atom (except nitrogen) or the like; Y is C-Z1 (wherein Z1 is dertorium, halogen or the like), N, P or the like; n1 is 2 or 3; n2 is 2-4; and n5 is 0, 1 or the like.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出壓公開番号 特開2000-63682 (P2000-63682A)

(43)公開日 平成12年2月29日(2000.2.29)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	テーマコード(参考)
C 0 8 L 101/00		C 0 8 L 101/00	4 J 0 0 2
C08K 5/00		C08K 5/00	
C08L 23/00		C 0 8 L 23/00	
25/00		25/00	
33/00		33/00	
	審査請求	未聞求 間求項の数10 OL (全 17	頁) 最終質に続く
(21)出願番号	特顯平10-238973	(71)出願人 000191250	
		新日本理化株式会社	
(22)出顧日	平成10年8月25日(1998.8.25)	京都府京都市伏見区営	图 法
		(72)発明者 長谷川 靖哉	
		京都府京都市伏見区南	i島矢倉町13番地 新
		日本理化株式会社内	
		(72) 発明者 曽我部 健作	
		京都府京都市伏見区前	i島矢倉町13番地 新
		日本理化株式会社内	
		(74)代理人 100065215	

最終頁に続く

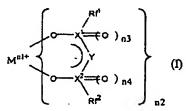
(54) 【発明の名称】 希土類錯体を含む樹脂組成物及び成形体

(57)【要約】

【課題】希土類錯体をポリマーマトリックス中に含む組成物及び光機能材料を提供する。

【解決手段】一般式(1):

【化1】



〔式中、M、n1、n2、Rf¹、Rf²、X¹、X²、n3、n4 及びYは、明細書で定義された通りである。〕で表され る希土類錯体をポリマーマトリクス中に含む組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I):

(化1)

【式中、Mは希土類原子を示し、n1は2または3を示す。n2は2、3または4を示す。Rf¹およびRf²は、同一又は異なって水素原子を含まない $C_1 \sim C_{12}$ の脂肪族基、水素原子を含まない芳香族基または水衆原子を含まない六テロ環基を示し: X^1 および X^2 は、同一又は異なってIVA族原子、窒素を除くVA族原子、酸素を除くVIA族原子のいずれかを示し、n3及Un4は、I0または1を示す。I1は、I2には I3とがは、I3とがは、I4と示す。I5と含まないI7と含まないI7と含まないI8を示す。I9は、I9と含まないI9と含まないI1の形態族基を示す。I1とI1の次素原子のと含n3はI1の次素原子の場合、I1、I1の次本くとも一方は水素原子を含まない芳香族基である。I1、I1には、I1の次本くとも一方は水素原子を含まない芳香族基である。I1、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I2には、I3には、I3には、I4には、I4には、I5には、I5には、I5には、I6には、I7により、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には、I1には

【化2】

$$M^{\text{BI+}} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ R^{3} \end{array} \right\}_{n2} (0)_{n5}$$

〔式中、M、 n_1 及び n_2 は前記に定義された通りである。R f^3 は水紫原子を含まない $C_1 \sim C_{22}$ の脂肪族基、水紫原子を含まない芳香族基または水紫原子を含まないヘテロ環基を示し; X^3 は、炭紫を除くIVA族原子、登紫を除くVA族原子、酸紫を除くIVA族原子のいずれかを示す。n5は0又は1を示す。1で表される希土類錯体をボリマーマトリクス中に含む組成物。

【請求項2】極性溶媒をさらにポリマーマトリクス中に 含む請求項1に記載の組成物。

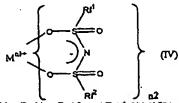
【請求項3】希土類錯体が一般式(III): 【化3】

$$M^{n1+} \begin{cases} O & Pr' \\ O & Pr' \\ O & Pr' \end{cases}$$
 (III)

〔式中、M、Rfl、Rf2、n1及びn2は前記に定義された通りである。〕で表される錯体である請求項1または

2に記載の組成物。

【請求項4】希土類錯体が一級式(IV): 【化4】



(式中、M、R f 1、R f 2、n1及びn2は前記に定義された通りである。)で表される錯体である請求項1または2に記載の組成物。

【請求項5】希土類錯体が一般式(V):

【化5】

(式中、M、Rf¹、Rf²、n1、n2及びZ² は前記に定 義された通りである。)で表される錯体である請求項1 または2に記載の組成物。

【請求項6】一般式 (VI)

[化6]

【請求項7】極性溶媒がDMSO-dgである請求項2 ~6のいずれかに記載の組成物。

【請求項8】ボリマーマトリクスが、ボリメチルメタクリレート、含フッ累ポリメタクリレート、ポリアクリレート、おリスチレン、ボリエチレン、ボリアロピレン、ポリブテン等のポリオレフィン、ボリビニルエーテル、含フッ累ボリビニルエーテル及びそれらの共重合体、エボキシ樹脂、ナフィオンからなる群から選ばれる請求項1~7のいずれかに記載の組成物。

【請求項9】請求項1~8のいずれかに記載の組成物を

含む光機能材料。

【請求項10】請求項1~8のいずれかに記載の組成物を含んでなる成形体

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、希土類錯体をポリマーマトリクス中に含む組成物に関する。本発明の組成物は、光ファイバー、発光材料、レンズなどの光機能材料として、さらには発光性形成材料として好適である。 【0002】

【従来の技術およびその課題】電子材料の開発は目覚ましく、オプトエレクトロニクスの分野で、光機能材料の開発が多数行われている。例えば、レーザー光線用電子デバイスとして、ネオジムを含むガラスが実用化されているが、その製造及び加工が難しく、製造費が高いため用途が限られている。

(0003)特開昭64-26583号には、発光性を有するボリマー組成物として、チオフェンおよびCF3を置換基として有するβ-ジケトン/Eu錯体のアンモニウム塩を含有する樹脂組成物を開示する。

【0004】しかしながら、該樹脂組成物は、発光特性が満足できるレベルに達していなかった。

【0005】本発明は、発光特性がさらに優れた組成物を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記の組成物、光機能材料及び成形体に関する。

【0007】項1. 一般式(I):

[8000]

[化7]

$$M^{ni+} \begin{cases} Q & X & X & X \\ Q & X & X \\ Q & X^2 & X^2 \\ Q & X^2 & X^3 \\ Q & X^4 & X^4 \\ Q & X^4 \\ Q & X^4 & X^4 \\ Q & X^4$$

【0009】(式中、Mは希土類原子を示し、n1は2または3を示す。n2は2、3または4を示す。Rf¹およびRf²は、同一又は異なって水素原子を含まないC₁~C₂₂の脂肪族基、水素原子を含まない芳香族基または水素原子を含まないヘテロ環基を示し:X¹およびX²は、同一又は異なってIVA族原子、登業を除くVA族原子、酸素を除くVIA族原子のいずれかを示し、n3及びn4は、0または1を示す。Yは、C-Z'(Z'は重水素、ハロゲン原子または水素原子を含まないC₁~C₂₂の脂肪族基を示す)、N、P、As、Sb又はBiを示す。但し、X¹が炭素原子のときn3は0であり、X²が炭素原子のときn4は0である。

【0010】但し、X1とX2とが同時に炭素原子の場

合、R f¹、R f²の少なくとも一方は水素原子を含まない芳香族基である。); または一般式(II)

(0011)

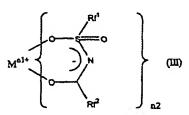
(化8)

【0013】項2. 極性溶媒をさらにポリマーマトリクス中に含む項1に記載の組成物。

【0014】項3. 希土類錯体が一般式(III):

[0015]

【化9】



・【0016】〔式中、M、Rf1、Rf2、n1及びn2は前 記に定義された通りである。〕で表される錯体である項 1または2に記載の組成物。

【0017】項4. 希土類錯体が一般式(1V):

[0018]

(化10)

$$M^{al^+} \begin{cases} O & R^{r^1} \\ O & S & O \\ R^{r^2} & a2 \end{cases}$$
 (IV)

【0019】〔式中、M、R f¹、R f²、n1及びn2は前 記に定義された通りである。〕で表される錯体である項 1または2に記載の組成物。

【0020】項5. 希土類錯体が一般式(V):

[0021]

【化11】

【0022】〔式中、M、R f1、R f2、n1、n2及び Z'は前記に定義された通りである。〕で表される錯体である項1または2に記載の組成物。

【0023】項6. 一般式 (VI)

(0024)

(化12)

【0025】〔式中、M、 n_1 及び n_2 は前記に定義された通りである。2"は、水素原子又は2"(2"は前記に同じ)を示す。 Rf^1 及び Rf^5 は、同一又は異なって水素原子を含まない C_1 ~ C_{22} の脂肪族基、水素原子を含まない芳香族基または水素原子を含まないへテロ環基を示す。〕で表される錯体と極性溶媒との分散ないし懸濁混合物をボリマーマトリクス中に含む組成物。

(0026)項7. 極性溶媒がDMSO- d_6 である項2~6のいずれかに記載の組成物。

【0027】項8. ポリマーマトリクスが、ボリメチルメタクリレート、含フッ素ポリメタクリレート、ポリアクリレート、オリスチレン、ポリエチレン、ポリプロビレン、ポリブテン等のポリオレフィン、ポリビニルエーテル、含フッ素ポリビニルエーテル及びそれらの共連合体、エボキシ樹脂、ナフィオンからなる群から選ばれる項1~7のいずれかに記載の組成物。

【0028】項9. 項1~8のいずれかに記載の組成物を含む光機能材料。

【0029】項10. 項1~8のいずれかに記載の組成物を含んでなる成形体。

[0030]

【発明の実施の形態】本発明において、 Rf^1 、 Rf^2 、 Rf^3 、 Rf^4 及び Rf^3 は、同一又は異なって水紫原子を含まない $C_1 \sim C_{22}$ の脂肪族基、水紫原子を含まない芳香族基または水紫原子を含まないヘテロ環基を示す。

【0031】水条原子を含まないC₁~C₁₂の脂肪族基 としては:

* パーフルオロアルキル基(C_nF_{2n+1} ; n=1-22)、パークロロアルキル基(C_nCl_{2n+1} ; n=1-22)などの直鎖又は分枝を有するパーハロゲン化アルキ

ル基、具体的には、トリクロロメチル、トリフルオロメ チル、ペンタクロロエチル、ペンタフルオロエチル、ヘ プタクロロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタ クロロイソプロピル、ヘプタフルオロイソプロピル、ノ ナクロロブチル、ノナフルオロブチル、ノナクロロイソ ブチル、ノナフルオロイソブチル、ウンデカクロロペン チル、ウンデカフルオロペンチル、ウンデカクロロイソ ペンチル、ウンデカフルオロイソペンチル、トリデカク ロロヘキシル、トリデカフルオロヘキシル、トリデカク ロロイソヘキシル、トリデカフルオロイソヘキシル、ペ ンタデカクロロヘプチル、ペンタデカフルオロヘプチ ル、ペンタデカクロロイソヘプチル、ペンタデカフルオ ロイソヘプチル、ヘプタデカクロロオクチル、ヘプタデ カフルオロオクチル、ヘプタデカクロロイソオクチル、 ヘプタデカフルオロイソオクチル、ノナデカクロロノニ ル、ノナデカフルオロノニル、ノナデカクロロイソノニ ル、ノナデカフルオロイソノニル、ヘンイコサクロロデ シル、ヘンイコサフルオロデシル、ヘンイコサクロロイ ソデシル、ヘンイコサフルオロイソデシル、トリコサク ロロウンデシル、トリコサフルオロウンデシル、トリコ サクロロイソウンデシル、トリコサフルオロイソウンデ シル、ペンタコサクロロドデシル、ペンタコサフルオロ ドデシル、ペンタコサクロロイソドデシル、ペンタコサ フルオロイソドデシル、ヘプタコサクロロトリデシル、 ヘプタコサフルオロトリデシル、ヘプタコサクロロイソ トリデシル、ヘプタコサフルオロイソトリデシルなど; * パーフルオロアルケニル基 (パーフルオロビニル) 基、パーフルオロアリル基、パーフルオロブテニル基 等)、パークロロアルケニル基などの直鎖又は分枝を有 するC2~C22パーハロゲン化アルケニル基、好ましく は、トリフルオロエチニル、トリクロロエチニル、ペン タフルオロプロペニル、ペンタクロロプロペニル、ヘブ タフルオロブテニル、ヘプタクロロブテニルなど:

* パーフルオロアルキニル基、パークロロアルキニル基などの直鎖又は分枝を有する $C_2 \sim C_{22}$ パーハロゲン化アルキニル基:

* パーフルオロシクロアルキル基($C_nF_{2n-1}: n=3~22$ 、好ましくは3~8、より好ましくは3~6)、パークロロシクロアルキル基($C_nCl_{2n-1}: n=3~22$ 、好ましくは3~8、より好ましくは3~6)などの $C_3~C_{22}$ パーハロゲン化シクロアルキル基、好ましくは、ペンタクロロシクロプロビル、ペンタフルオロシクロプロビル、ヘプタクロロシクロブチル、ヘプタフルオロシクロブチル、ノナクロロシクロベンチル、ノナフルオロシクロベンチル、ウンデカフロマンチル、ウンデカフルオロシクロへキシル、ウンデカフルオロシクロへアナル、ペンタデカクロロシクロオクチル、ペンタデカクロロシクロオクチル、ペンタデカクロロシクロオクチルなど:

* パーフルオロシクロアルケニル基 (パーフルオロシ

クロペンテニル基、パーフルオロシクロヘキセニル基など)、パークロロシクロアルケニル基などの $C_3 \sim C_{11}$ 、好ましくは $C_3 \sim C_8$ 、より好ましくは $C_3 \sim C_8$ のパーハロゲン化シクロアルケニル基;及び

* パーフルオロベンジル基、パーフルオロフェネチル 基などのパーハロゲン化アラルキル基が挙げられる。

【0032】「水衆原子を含まない芳香族基」の芳香族 基としては、フェニル、ナフチル、アントラニル、フェ ナントリル、ピレニル等を;「水業原子を含まないヘテ ロ環基」のヘテロ環基としてはビリジル、チエニル、ビ ロリル、ピリミジニル、キノリル、イソキノリル、ベン ズイミダゾリル、ベンゾピラニル、インドリル、ベンゾ フラニル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピフェニルなど が挙げられ、これら芳香族基及びヘテロ環基の全ての水 **紫原子は、フッ紫原子、塩素原子、臭素原子などのハロ** ゲン原子、ニトロ基、C1~C1のパーハロゲン化アルキ ル基(トリフルオロメチル等)、Cl~Clのパーハロゲー ン化アルコキシ基(トリフルオロメトキシ等)、C,~ C₅のパーハロゲン化アルキルカルボニル基(トリフル オロアセチル等)、C1~C1のパーハロゲン化アルキレ ンジオキシ基 (ジフルオロメチレンジオキシ等)、C, ~C₅のパーハロゲン化アルケニル基(パーハロゲン化 ピニル等)、パーハロゲン化フェノキシ基、C2~C22 パーハロゲン化アルキルカルボニルオキシなどの水素原 子を含まない置換基で置換されている。水衆原子を含ま ない芳香族基の具体例としては、パーフルオロフェニル 基、パークロロフェニル基、パーフルオロナフチル基、 パークロロナフチル基、パーフルオロアントラニル基、 パークロロアントラニル基、パーフルオロフェナントリ ル基、パークロロフェナントリル基が挙げられ、水素原 子を含まないヘテロ環基としては、パーハロゲン化2-ピリジル基などが挙げられる。

【0033】前記パーハロゲン化芳香族基、パーハロゲン化へテロ環基、パーハロゲン化アラルキル基の芳香環又はヘテロ環に結合したハロゲン原子の1または2以上は、シアノ、ニトロ、ニトロソ、 C_1 ~ C_4 パーハロゲン化アルコキシ、 C_2 ~ C_5 パーハロゲン化アルコキシカルボニル、 C_2 ~ C_{12} パーハロゲン化アルキルカルボニルオキシ等の水素原子を含まない置換基で置換されていてもよい。

【0034】また、 $C_1 \sim C_{12}$ パーハロゲン化アルキル基、 $C_2 \sim C_{22}$ パーハロゲン化アルケニル基、 $C_2 \sim C_{22}$ パーハロゲン化アルキニル基の任意の位置のC - C 単結合の間に-O-、-COO-、-COO-、を1個または複数個介在させて、エーテル、エステルまたはケトン構造としてもよい。

【0035】Mで表される希土類元素としては、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luなどのランタン系列元素が挙げられ、好ましくはNd、Eu、TbおよびY

りが挙げられる。

【0036】X¹およびX²は、C、Si、Ge、Sn、PbなどのIVA族原子、P、As、Sb、Biなどの窒素を除くVA族原子、S、Se、Te、Poなどの酸素を除くVIA族原子のいずれかを示し、好ましくはC、S、PまたはSe、より好ましくはCまたはSを示す。 【0037】X³は、Si、Ge、Sn、PbなどのIVA族原子、P、As、Sb、Biなどの窒素を除くVA族原子、S、Se、Te、Poなどの酸素を除くVIA族原子のいずれかを示し、好ましくはSを示す。

【0038】YはC-Z'(Z'は前記に同じ)、N、P、As、SbまたはBi、好ましくはC-Z'(Z'は前記に同じ)、NまたはPを示す。

【0039】Z¹ は重水素、ハロゲン原子または水業原子を含まない $C_1 \sim C_{22}$ の脂肪族基、好ましくは重水素または直鎖又は分枝を有する $C_1 \sim C_{22}$ のパーハロゲン化アルキル基を示す。

【0040】2"は、H又は2"を示す。

【0041】n1は2または3、好ましくは3を示す。

【0042】n2は2~4、好ましくは2または3、特に3を示す。

【0043】n3、n4、n5は0または1である。特に X¹、X²またはX³がSの時、n3、n4またはn5は1が好 ましく、X¹またはX²がCのとき、n3またはn4は0であ る。

【0044】本発明の錯体には、配位子が2分子、3分子又は4分子配位可能であるが、4分子配位した錯体は、少量成分であり、2分子又は3分子の配位子、特に3分子の配位子が配位した錯体が主要な成分である。

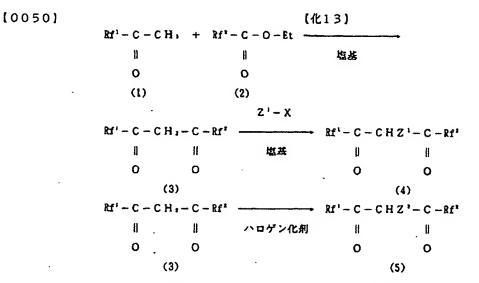
【0045】本発明の配位子は、一般式(I)で示されるように、配位子の2位の水素又は重水素が脱離した1個アニオンの配位子として通常希土類イオンに配位するが、2位の水素又は重水素が脱離していない中性のジケトン配位子として配位することもできる。このような中性のジケトン配位子が配位した錯体も本発明の錯体に包含される。

【0046】一般式(I)で表される希土類錯体のうち、より好ましい希土類錯体としては、一般式(III)で表される希土類錯体、一般式(IV)で表される希土類錯体、一般式(V)で表される希土類錯体、一般式(VI)で表される希土類錯体が挙げられる。

【0047】本発明の組成物に配合される錯体の配位子は、公知の化合物であるか、公知の化合物から容易に合成することができ、例えばJournal of Chemical and Engineering Data. Vol.16. No.3. (1971)、および、The Journal of Organic Chemistry, Vol.35, No.4, (1970)などの文献に記載の方法に従い合成できる。

【0048】X¹ = X² = Cである化合物の合成法を、スキーム 1 に示す。

(0049) スキーム1



【0051】〔式中、 Rf^1 及 URf^2 は前記に同じ。 Z^1 は 水素原子を含まない $C_1 \sim C_{22}$ の脂肪族基を示す。Xは 臭素原子又はヨウ素原子を示し、 Z^2 はハロゲン原子を示す。〕

ケトン化合物(1)をエステル化合物(2)と、溶媒中塩基の存在下に反応させて一般式(3)の化合物を得る。反応は、ケトン化合物(1)1モルに対し、エステル化合物(2)1~2モル程度、塩基を1モル~過剰量用い、−78℃から溶媒の週流する温度下に1~24時間反応させることにより、有利に進行する。塩基としては、ナトリウムアルコキシド、NaH、ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド(LDA)などが用いられ、溶媒としては、THF、エーテル等のエーテル系溶媒、DMF、DMSO、ホルムアミドなどが挙げられる。

【0052】一般式(3)の化合物を溶媒中塩基の存在下にR-Z¹と反応させて、一般式(4)の化合物を得る。反応は、一般式(3)の化合物1モルに対し、R-Z¹を1モル程度、塩基を1モル~過剰量用い、-78℃から溶媒の湿流する温度下に1~24時間反応させることにより、有利に進行する。塩基としては、ナトリウムアルコキシド、NaH、ブチルリチウム、LDAなど

が用いられ、溶媒としては、THF、エーテル等のエーテル系溶媒、DMF、DMSO、ホルムアミドなどが挙 げられる。

【0053】一般式(3)の化合物を溶媒中塩基の存在下にハロゲン化剤と反応させて、一般式(5)の化合物を得る。反応は、一般式(3)の化合物1モルに対し、ハロゲン化剤を1モル程度用い、氷冷下一室温程度の温度下に30分~5時間反応させることにより、有利に進行する。ハロゲン化剤としては、臭紫、塩紫などの分子状ハロゲン、Nーブロムコハク酸イミド、Nークロロコハク酸イミドなどが用いられ、溶媒としては、クロロホルム、四塩化炭素、塩化メチレン、アセトン、エーテル、THFなどが挙げられる。

【0054】一般式(4)または(5)の化合物は、単水素化メタノール等で処理することにより容易にジケトンの間の水素原子を重水素に置換できる。

【0055】本発明の化合物はまた、以下のスキーム2 に従い合成することもできる。

【0056】<u>スキーム2</u>

(0057)

【化14】

【0058】〔式中、Rf¹、Rf²、X¹、X²、Y及びn3は 前記に同じ。〕

化合物(7)をヘキサメチルジシラザンと反応させてトリメチルシリル(TMS)化(7a)した後、化合物(6)と反応させて目的の一般式(8)の化合物を得る。化合物(7)1モルに対しヘキサメチルジシラザンを1~1.1モル程度、化合物(6)を1モル程度使用し、室温から溶媒の遠流する程度の温度下に1~5時間程度反応させることにより、反応は有利に進行する。

【0059】一般式(I)~(VI)で表される錯体は、対応する配位子と、希土類金属酸化物、希土類金属水酸化物、希土類金属アミド及び代物、希土類金属アルコキシド、希土類金属アミド及び希土類金属塩からなる群から選ばれる少なくとも1種の希土類金属化合物を、例えば溶媒中で混合して製造することができる。

【0060】本発明にかかる希土類錯体は、1種もしくは2種以上の配位子を用いて作成することが可能であり、さらに、錯体を形成する希土類原子は1種もしくは2種以上の化合物を用いて差し支えない。

【0061】一般式(I)~(VI)で表される希土類錯体の具体的な製造方法は以下の通りである。

【0062】即ち、対応する配位子を溶媒に溶かし、さらに希土類金属化合物(粉末状、顆粒状等の形態を問わない)を加え、室温~100℃の温度下、1時間~100時間程度撹拌する。次いで生成物を晶析或いは液一液抽出等の精製手段を行うことにより希土類錯体を得ることができる。更に、クロロホルム、メタノール等の溶媒を用いて再結晶を行っても差し支えない。

【0063】希土類金属化合物中、希土類金属酸化物と しては、3価であるM₂O₂(Mは希土類元子を示す。) が挙げられるが、MO、M,O7等の他の形態の酸化物を 使用してもよい。同様に希土類金属水酸化物としてはM (OH) n, が例示され; 希土類金属アルコキシドとして は、M (OR1) n₁ (R1は、アルキル基)が例示され; 希土類金属アミドとしては、M(NR®R®)。(R®及び Rbは同一又は異なって水素、アルキル、フェニル)が 「例示され;希土類金属塩としてはM3・(Z)n1(Zは塩 索イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ索イオン、 1/2硫酸イオン、硝酸イオン、酢酸イオン等のモノカル ボン酸イオン、1/2 (シュウ酸イオン、コハク酸イオ ン、マロン酸イオンなどのジカルボン酸イオン)、1/3 (クエン酸などのトリカルボン酸イオン)、1/3リン酸 イオン等の陰イオン)が例示される(n,は前記に定義 された通りである)、

【0064】一般式(I)~(VI)で表される錯体を製造するに際し用いる溶媒としては、特に限定されず、いずれの溶媒でも用いることが可能である。具体的にはプロトン性溶媒、非プロトン性溶媒が挙げられる。プロトン性溶媒としては、水、メタノール、エタノール糖のアルコール性溶媒が挙げられ、非プロトン性溶媒としてはアセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、クロロホルム、塩化メチレン等のハロゲン系溶媒、DMSO、DMF等が挙げられる。中でも水が好ましい。また、用いる溶媒の量としては、配位子と希土類金属化合物の総量(1重量部とする)に対して1~100

重量部程度が例示され、好ましくは1~20<u>重量</u>部程度である。

【0065】一般式(II)の錯体は、上記の希土類金属化合物と公知物質であるRf3-X3(=O)n5+1(OH)の当量又は過剰量とを水中で反応させることにより、得ることができる。一般式(II)の錯体は、H2Oが配位しやすく、H2Oが配位すると光機能材料としての性質を失うため、一般式(I)の錯体に比べてH2Oに対しより不安定である。

【0066】一般式(I)~(VI)で表される希土類錯体を製造するに際し用いられる希土類金属化合物の量としては、相当する配位子1当量に対し1~10当量であり、好ましくは1.05~3当量である。また、一般式(II)の希土類錯体も上記と同様の混合比にて製造可能である。

【0067】一般式(I)~(VI)で表される希土類錯体が配位水を含む場合、例えば該錯体のサンプルにMe ODまたは D_2 O等の重水衆化溶媒を加え、サンプル/重水衆化溶媒を凍結させて真空状態にした後、室温で24時間程度放置し、次いで重水衆化溶媒を留去して配位している H_2 Oを D_2 Oに変換することができる。

【0068】本発明の組成物は、希土類錯体をポリマーマトリクスに分散ないし懸濁し、必要に応じてDMSOなどの極性溶媒を添加して製造することができる。

【0069】希土類錯体を分散させるポリマーマトリク スとしては、希土類錯体をブレンドしたときに半透明な いし透明な組成物となるものが好ましく、例えばポリメ タクリレート (PMA)、ポリメチルメタクリレート (PMMA)、ポリ(ヘキサフルオロイソプロビルメタ クリレート) (P-iFPMA)、ポリ (ヘキサフルオ ローnープロピルメタクリレート) (P-nFPMA) 等の含フッ索ボリメタクリレート、ボリアクリレート、 ポリフルオロイソプロビルアクリレートを代表とする含 フッ衆ポリアクリレート、ポリスチレン、ポリエチレ ン、ボリプロピレン、ボリブテン等のポリオレフィン、 含フッ索ポリオレフィン、ポリビニルアルコール、ポリ ビニルエーテル、ポリ (ペルフルオロプロポキシ) ビニ ルエーテルを代表とする含フッ索ポリビニルエーテル、 ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニルあるいはそれらの共産 合体、セルロース、ポリアセタール、ポリエステル、ポ リカーボネート、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリ イミド樹脂、ポリウレタン、ナフィオン、石油樹脂、ロ ジン、ケイ素樹脂等が例示され、好ましくは、ポリメチ ルメタクリレート、含フッ紫ポリメタクリレート、ポリ アクリレート、含フッ条ポリアクリレート、ポリスチレ ン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテンなどの ポリオレフィン、ポリピニルエーテル、含フッ紫ボリビ ニルエーテル及びそれらの共重合体、エポキシ樹脂、ナ フィオンである。これらのポリマーは、目的、用途に応 じて適宜選択すればよい。

【0070】希土類錯体をポリマーへ分散ないし懸濁させる方法としては、特に限定されず、(1)溶融樹脂中に希土類錯体を混合する方法、(2) ポリマー協粉末に希土類錯体を分散させた後、溶融させる方法、(3) モノマーと希土類錯体とをAIBN、過酸化ラウロイル等の重合開始剤を用いて共重合させる方法、(4) 高分子膜作成に有用な、高分子溶液に希土類錯体を混合した役溶媒を除去することによるキャスト法、(5) スピンコート法、(6) 共蒸着法等のいずれも可能である。

【0071】本発明の組成物100重量部には、希土類錯体を0.001~20重量部程度、好ましくは0.1~10重量部程度;ポリマーを99.999~80重量部程度、好ましくは99.9~90重量部程度を含む。【0072】希土類錯体をポリマーマトリクス中に含む組成物100重量部に対し、極性溶媒を0~2000重量部、好ましくは0~1000重量部を添加することができる。

【0073】極性溶媒を含有することが可能なポリマーマトリックスとしては一般式(I)~(V)で表される希土類錯体の他に、一般式(VI)で表される希土類錯体が挙げられる。一般式(VI)で表される希土類錯体含有ポリマーは公知のものを含むが、ポリマーマトリクス中に希土類錯体の極性溶媒分散液又は懸濁液を添加することによりその発光強度、量子収率等を大幅に増加させることが可能となる。

【0074】極性溶媒を加える方法としては、特に限定されない。具体的な方法としては、(1) 希土類錯体の極性溶媒溶液、懸濁液、或いは分散液をあらかじめ調製し、このものをポリマーマトリックスに混合させる方法、(2) 希土類錯体、極性溶媒、ポリマーマトリックスを同時に混合する方法、(3) 希土類錯体をポリマーマトリックスと極性溶媒との混合物に加える方法等が挙げられる。

【0075】中でも、希土類錯体の極性溶媒溶液、懸濁液、取いは分散液をあらかじめ調製し(好ましくは極性溶媒の溶液、分散液ないし懸濁液の状態で、0.01~48時間、より好ましくは0.1~6時間放置)、このものをポリマーマトリクス中に混合させる方法が好ましい。

【0076】極性溶媒としては、DMSO(ジメチルスルホキシド)、DMF(ジメチルホルムアミド)、ホルムアミド、アセトアミド、HMPA(ヘキサメチルリン酸トリアミド)、ニトロメタンなどの水より誘電率の高い非プロトン性極性溶媒が挙げられ、好ましくはDMSOである。更には、重水素置換された極性溶媒、例えばDMSO-d。がより好ましい。

【0077】本発明の組成物には、その機能を損なわない限り、樹脂の特性を改善する目的で添加剤を添加しても差し支えない。具体的な添加剤としては、ジブチルフタレート、ジオクチルフタレート等のフタル酸ジエステ

ル、アジピン酸ジオクチル等の二塩基酸ジエステル、ペ ンタエリスリトールテトラベンゾエート等のポリオール エステル、ロジン酸石酸、ステアリン酸石酸、オレイン 酸石鹸、ラウリル硫酸ナトリウム、ナトリウムジエチル ヘキシルスルフォサクシネート、ナトリウムジオクチル スルフォサクシネート等の界面活性剤を成分とする分散 剤或いはアルキルスルフォネート、アルキルエーテルカ ルポン酸等のアニオン性帯電防止剤、ポリエチレングリ コール誘導体、ソルビタン誘導体等のノニオン性帯電防 止剤、四級アンモニウム塩、アルキルピリジウム等のカ チオン性帯電防止剤、タルク、脂肪酸金属塩、ソルビト ール系の結晶化核剤、ブチルヒドロキシフェノール等の フェノール系酸化防止剤、チオエーテル系酸化防止剤、 リン系酸化防止剤、顔料、光安定剤、架橋剤、架橋促進 剤、難燃剤、加工助剤等が挙げられる。これらは樹脂1 00重量部に対して0.01重量部~10重量部添加さ

【0078】本発明に係る希土類錯体含有樹脂組成物を成形するに際しては、一旦調製した希土類錯体含有樹脂組成物を再度溶融させて成形する方法、希土類錯体含有樹脂組成物を調製する時点で同時に成形する方法がある。また、その成形手段としては、射出成形、押出成形、ブロー成形、圧空成形、回転成形、フィルム成形等の従来公知の成形方法のいずれをも採用可能である。

【0079】また、希土類錯体をポリマーマトリクス中に高濃度に配合して押出成形してマスターバッチとすることができる。

【0080】成形体の形状としては特に限定されず、ロッド状、フィルム状、板状、円筒状、円形、楕円形等あるいは玩具、装飾品等特殊な形状のもの、例えば星形、多角形形状が例示される。

【0081】上記いずれの成形方法、成形体において も、本発明に係る樹脂組成物を含んでなる成形体は、発 光特性を有する。

[0082]

【発明の効果】本発明の組成物は、光の発光強度および 変換効率が高く、発光材料、光ファイバー、レンズなど の用途に有用であり、CDプレーヤー、光ディスク、フ ァクシミリ、リモコン、コピー機器、レーザープリンタ ー、大型ディスプレイ、医原用レーザー、レーザー加工 計測、印刷関連などの光機器に使用でき、具体的には、 レーザー衆子、発光ダイオード、液晶、光ファイバー、 光検知器、太陽電池などへの応用が可能である。

【0083】更には、各種プラスチック製品に適用することにより、内容物、或いは内容構造が透視可能な、発光性を有する形成材料として用いることが可能である。 又、信号機又は自動車のライト反射板、各種交通機識の 器材として、発光性の装飾品用案材としても有用である。

【0084】以下、本発明を実施例に基づきより詳細に

説明する。

(0085)

【夷施例】参考例1

 $C_8F_{17}SO_2NHSO_2C_8F_{17}$ (POS) の合成 窒果雰囲気下、 $18mmoloC_8F_{17}SO_2NHNac$ ((CH₃) $_3Si$] $_2NH$ (18ml, 86.5mmol) を滴下した。ジオキサン2回を添加し、120で 8時間遠流を行った後、[(CH $_3$) $_3Si$] $_2NHを留 去し、<math>12$ 時間真空乾燥を行った。乾燥アセトニトリル 30回及び $C_8F_{17}SO_2F$ (21mmol) を添加し、100℃で48時間遠流した。その後アセトニトリルを留去し、硫酸を用いてプロトン化を行った後、エーテル抽出及び昇華法により、目的物(白色固体、収率12%)を得た。

[0086] IR(cm⁻¹):1373 (S=Ost.), 1237 (C-Fst.), 1206 (C-Fst.), 1 151 (S=Ost.)

¹⁸F-NMR (アセトン-d₆, 標準物質C₆F₆; pp m):-79.51(3F),-111.59(2

F), -118. 43 (2F), -120. 10 (6

F), -121.06(2F), -124.59(2F).

【0087】参考例2

 $C_4F_9SO_2NHSO_2C_4F_9$ (PBS) の合成 $C_6F_{13}SO_2NHNa及びC_6F_{13}SO_2F$ に代えて、各々 $C_4F_9SO_2NHNa及びC_4F_9SO_2F$ を用いた他は 参考例1と同様にして $C_4F_9SO_2NHSO_2C_4F_9$ (白色固体、収率26%) を得た。

[0088] IR(cm⁻¹):1373 (S=Ost.), 1237 (C-Fst.), 1206 (C-Fst.), 1 151 (S=Ost.)

19F-NMR (アセトン-d₆, 標準物質C₆F₆; ppm):-79.31(6F),-111.47(4F),-119.18(4F),-124.19(4F).

【0089】参考例3

Nd (POS)₃錯体の合成

参考例1で得た $C_8F_{17}SO_2NHSO_2C_8F_{17}$ (0.8 g、0.82mmol)を30mlの蒸留水に溶かし、Nd $_2O_3$ (46mg、0.14mmol)を加え、室温で3日間撹拌した。沈殿した固体を沪過、水洗後、メタノールに溶解させて遠心分離し、沪過を行って未反応のNd $_2O_3$ を除去した。メタノールを留去して目的の錯体(Nd(POS) $_2$:赤柴色固体)を得た。得られた錯体は、示差熱分析(DSC)により、水を有していないことを確認した。

[0090] IR(cm⁻¹): 3449 (O-Hst.), 1368 (S=Ost.), 1237 (C-Fst.), 1. 150 (S=Ost.)

19F-NMR(アセトンーde、標準物質CeFe:pp

m):-79.33(3F).-111.24(2 F).-118.07(2F).-119.81(6 F).-120.78(2F).-124.29(2 F).

(0091) POSの代わりにPBSを用いて同様の操作を行うことによりNd(PBS) 3 の赤紫色固体を得た。

【0092】参考例4

Eu (POS)₃ 錯体の合成

参考例1で得た $C_8F_{17}SO_2NHSO_2C_8F_{17}$ (0.8 g、0.82mmol)を30mlの蒸留水に溶かし、 $E_{u_2}O_3$ (50mg、0.14mmol)を加え、室温で3日間撹拌した。沈殿した固体を沪過、水洗後、メタノールに溶解させて遠心分離し、沪過を行って未反応の $E_{u_2}O_3$ を除去した。メタノールを留去して目的の錯体(E_{u} (POS) $_3$;白色固体)を得た。得られた錯体は、示差熱分析(DSC)により、水を有していないことを確認した。

[0093] IR(cm⁻¹):1354 (S=Ost.), 1237 (C-Fst.), 1209 (S-Fst.), 1 056 (S=Ost.)

1⁹F-NMR (アセトン-d₆, 標準物質C₆F₆; ppm):-79.2(3F), -111.33(2F), -118.15(2F), -119.87(4F), -120.8(2F), -124.29(2F)。 【0094】参考例5

Tb (POS)₃錯体の合成

希土類金属化合物として、 Tb_4O_7 (60mg、O.82mmol)を用いた他は参考例4と同様の方法により目的の錯体(Tb (POS) $_3$: 白色結晶)を得た。得られた錯体は、示差熱分析(DSC)により、水を有していないことを確認した。

[0095] IR(cm]):1353 (S=Ost.), 1243 (C-Fst.), 1208 (C-Fst.), 1 056 (S=Ost.)

1⁹F-NMR (アセトン-d₆, 標準物質C₆F₆; ppm):-79.3(3F),-111.1(2F),-118.0(2F),-119.9(4F),-120.9(2F),-124.4(2F)。

【0096】参考例6

Nd (O₃SCF₃)₃の合成

 $CF_3SO_3H(2モル)$ の水溶液に $Nd_2O_3(1モル)$ を加え、室温で放置して結晶を析出させた。得られた赤紫色の針状晶を沪取し、2日間真空乾燥して目的とする $Nd(O_3SCF_3)_3$ を得た。得られた結晶は、TG-DTA測定の結果から、6水和物であることが確認された。

[0097]

元粜分析 (MdC, H,, O,, F, S,)

С н

計算値 5.15 1.73

実拠値 5.01 1.82

IR (cm^{-1}) : 3449 (O-Hst.), 1638 (O-H δ), 1263 (C-Fst.), 1180 (S-O st.).

19F-NMR (アセトン-d₆, 標準物質C₆F₈; ppm):-77.03

 Nd_2O_3 の代わりに Eu_2O_3 を用いて同様の操作を行うことにより、 $Eu(O_3SCF_3)_3$ を得た。

[0098] 参考例7

Nd (O₃SC₈F₁₇)₃·6D₂Oの合成

0.34 Mのペンタフルオロオクタンスルホン酸水溶液 30 ml e 0.56 g (1.72 mm o 1) のN d $_2$ O_3 に 添加した後、24 時間室温で撹拌し、紫色固体を得た。これを $_2$ 元 水洗しクロロホルム、メタノールの混合溶 媒で再結晶を行い、紫色針状結晶を得た。得られた結晶を 5 mm H g $_2$ で 2日間乾燥した。 収率 30 %。 得られた 結晶は、 1 T G $_2$ 日 可 1 不 別定の結果から、 1 6 水和物であることが確認された。

【0099】 $IR(cm^{-1}): 3432$ (O-Hst.), 1637 (O-H δ), 1241 (C-Fst.), 12 04 (C-Fst.), 1152 (S-Ost.) ¹⁹ F-NMR (Pセトン- d_6 , 標準物質 C_6F_6 ; PP m):-79.61 (3F), -112.85 (2F), -119.16 (2F), -120.30 (6F), -121.19 (2F), -124.67 (2F)

得られたNd(O₃SC₈F₁₇)₃·6H₂O(80mg)をCD₃OD(2.0ml)に溶解し、-78℃で脱気し、更に室温で24時間放置した。次いでCD₃ODを留去することにより、Nd(O₃SC₈F₁₇)₃·6D₂Oを得た。本化合物をH-NMRで測定することにより、H₂OがD₂Oに置換されていることを確認した。

【0100】参考例8 Nd (PDDH)₃の合成

Journal of Chemical and Engineering Data, Vol.16, No.3 (1971) の記載に従い、4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9, 10.10,10-ペンタデカフルオロー1-ペンタフルオロワュニルー1.3-デカンジオン(以下、"PDDH"と略す)を製造した。PDDH (O. 52g)をエーテルに溶かし、硝酸ネオジム六水和物(880mg)の水溶液を加え、室温で3日間激しく撹拌した。沈殿した固体を沪過、水洗役、メタノールに溶解させて遠心分離し、沪過を行って未反応の硝酸ネオジムを除去した。メタノールを留去して目的の錯体(Nd (PDDH)3:赤紫色固体)を得た。得られた錯体は、示差熱分析 (DSC)により、水を有していないことを確認した。

(01.01) IR(cm-1):3410(O-H),16

23 (C=O), 1513 (C-H), 1243, 12 11 (C-F), 1148 (C-O).

[0103] H-NMR &6.00ppm (1 H. S. C-H).

【0104】参考例9

TBSAの合成

冷却管付きの3つロフラスコ(100ml)中に、窒素 気流下で、THF30mlを加え、引き続き、CF₃C ONH₂(6.44g、57mmol)(和光純蒸社 製)、及びトリエチルアミン (11.5g、114mm 01)を溶解し、65℃にて1時間撹拌した。引き続 き、C₄F₉SO₂F(17.2g、57mmol)(東 京化成社製)を滴下し、常圧下、30時間還流を行っ た。続いて、減圧下、THFを留去したのち、残渣をエ ーテルに溶解し、イオン交換水にてエーテル層を洗浄し た。更に、硫酸マグネシウム上でエーテルを乾燥した 後、エーテルを減圧下で留去した。引き続き、減圧蒸留 (220℃、3mmHg) することにより、淡黄色液体 状の[C₄F₉SO₂NCOCF₃] · Et₃NH · (以下、 TBSAと略す)を24.6g、87%の収率で得た。 【0105】IR(塗りつけ):3110、2822、 1668, 1326, 1236, 1197, 1141c m*1.

19F-NMR (アセトン-d₆、標準化合物 ヘキサフルオロベンゼン、δ、ppm)-74、20 (3F)、 -79、37 (3F)、-112、42 (2F)、-1 19、23 (2F)、-124、19 (2F)。

[0106] $^{1}H-NMR$ ($\mathcal{T}t+\mathcal{V}-d_{6}$, δ , pp m): 1.4 (3H×3), 3.5 (2H×3), 8.0 (NH),

 $(0107)^{13}C-NMR(Tthy-d_6, \delta, pp$ m): $108\sim124(C3F8)$, 141, 26(CF2), 137, 46(CF2), 162, 78(CO).

【0108】元素分析値 C₁₂H₁₆O₃N₂F₁₂S: 理論値(%)C:29.03、H:3.26、N:5. 64、

【0109】 奥测值 (%) C:28.89、H:3.35、N:5.81。

[0110] UV (λmax): 334nm (アセトン).

【0111】参考例10

HBSBの合成

冷却管付きの3つロフラスコ(100ml)中に、窒素 気流下で、THF(30ml)を加え、引き続き、C。 $F_9 SO_2F (17.2g、57mmol) (東京化成社製)、及びトリエチルアミン (11.5g、114mmol)を溶解し、室温にて1時間損拌した。引き続き、<math>C_3F_7CONH_2 (11.86g、57mmol) (東京化成社製)を滴下し、常圧下、30時間室温にて損拌を行った。続いて、減圧下、THFを留去したのち、残液をエーテルに溶解し、イオン交換水にてエーテル層を洗浄した。更に、硫酸マグネシウム上でエーテルを乾燥した後、エーテルを減圧下で留去した。引き続き、減圧蒸留(260℃、3mmHg)することにより、淡黄色液体状の <math>\{C_4F_9SO_2NCOC_3F_7\}$ - Et_3NH ・ (以下、HBSBと略す)を22、75g、81%の収率で得た。

【0112】IR(塗りつけ):3102、2821、1667、1325、1217、1139cm⁻¹、1³F-NMR(アセトン-d₆、δ、ppm)-79、29(3F、3F)、-112、50(2F)、-115、75(2F)、-119、10(2F)、-124、15(2F)、-124、73(2F)、【0113】「H-NMR(アセトン-d₆、δ、ppm):1、4(3H×3)、3、4(2H×3)、7、8(NH)。

(0114) UV (入max): 334nm (アセトン).

【0115】参考例11

Nd (PMS)₃の製造

市販の $CF_3SO_2NHSO_2CF_3$ (g、1.12mmo1) (fluka社製)を30m1の蒸留水に溶かし Nd_2O_3 (46mg、0.14mmo1)を加え、室温で3日間 撹拌した。水を留去の後、沈殿した固体を塩化メチレン で洗浄し、得られた固体を更にメタノールに溶解、沪過を行って未反応の Nd_2O_3 を除去した。メタノールを留 去して目的とする $Nd(PMS)_3 \cdot nH_2O:$ 赤柴固体を得た。

[0116]

19F-NMR:-77.53 (m.6F,CF₃) 1H-NMR:none (結晶水として2.06ppm) UV (MeOH):352,522,576,744、 801、865nm

参考例12

同様の方法によりEu (PMS)₃: 白色固体を得た。 【0117】

19F-NMR:-77.51 (m.6F, CF₃) 1H-NMR:none (結晶水として2.06ppm) UV (MeOH):362、376、394、465、 527nm

参考例13

Nd (PES)₃の製造例

原料としてC₂F₅SO₂NHSO₂C₂F₅を用い上記と同様の方法によりEu (PES)₃: 白色固体、Nd (P

ES)₃:赤柴固体を得た。 (0118) 参考例14 Nd (TBSA)₃の合成

参考例9で得られたTBSA(10.2g、25.6mmol)を、硝酸ネオジム六水和物(2.8g、6.4mmol)のアセトン溶液(20ml)に加え、室温で3日間激しく撹拌した。続いて、減圧下アセトンを留去した後に、残渣をエーテルに溶解し、イオン交換水にてエーテル層を洗浄した。エーテルを減圧下で留去した後、残渣にクロロホルム・ヘキサン溶液を加えて沈殿させることにより目的の錯体(Nd(TBSA)。: 青紫色固体、180mg、0.14mmol、収率2.2%)を得た。

[0119] IR (KBr): 1626 (C=0), 1 317 (S=0), 1234 (C-F), 1202 (C -F), 1166 (C-F) cm⁻¹.

 $\{0120\}^{19}F-NMR\ (\mathcal{T}+\mathcal{V}-d_6,\ \delta,\ pp\ m)-73.67\ (t.3F,CF_3),-79.40\ (t.3F,CF_3),-112.86\ (t.2F,CF_2),-119.49\ (br,2F,CF_2),-124.35\ (br,2F,CF_2).$

 $(0121)^{13}C-NMR$ (\mathcal{T} th \mathcal{Y} -d₆, δ , pp m): $108\sim127$ (C3F8), 141. 15 (CF2), 137. 21 (CF2), 167. 67 (CO).

【0122】参考例15

Nd (HBSB)₃の合成

参考例10で得られたHBSB(2.92g、4.9mmol)を、硝酸ネオジム六水和物(0.80g、1.8mmol)のアセトン溶液(8ml)に加え、室温で3日間激しく撹拌した。続いて、減圧下アセトンを留去した後に、残渣をエーテルに溶解し、イオン交換水にてエーテル層を洗浄した。エーテルを減圧下で留去した後、残渣にクロロホルム・ヘキサン溶液を加えて洗設させることにより目的の錯体(Nd(HBSB)3: 骨紫色固体、60mg、0.04mmol、収率2.3%)を得た。

[0123] $^{19}F-NMR$ ($\mathcal{T}t+\mathcal{V}-d_8$, δ , pp m) -79. 13 (t, 3F, CF_3), -79. 42 (t, 3F, CF_3), -112. 88 (br. 2F, CF_2), -115. 58 (br. 2F, CF_2), -1 19. 93 (br. 2F, CF_2), -124. 39 (t, 2F, CF_2), -124. 62 (t, 2F, CF_2).

【0124】参考例16

Eu (TBSA)₃の合成

参考例9で得られたTBSA(6.9g、13.9mm ol)を、硝酸ユーロビウム六水和物(2.1g、4.6mmol)のアセトン溶液(10ml)に加え、室温 で3日間激しく撹拌した。続いて、減圧下アセトンを留 去した後に、残渣をエーテルに溶解し、イオン交換水にてエーテル層を洗浄した。エーテルを減圧下で留去した後、残盗にクロロホルム・ヘキサン溶液を加えて沈設させることにより目的の錯体(Eu(TBSA)3:白色固体、240mg、0.18mmol、収率10.2%)を得た。

 $\{0125\}^{19}F-NMR(7t+y-d_6, \delta, ppm):-74.20(t, 3F, CF_3), -79.3$ $1(t, 3F, CF_3), -112.21(t, 2F, CF_1), -118.92(br, 2F, CF_1), -124.11(br, 2F, CF_1),$

【0126】試験例1

参考例で得られたNd(POS) $_3$ 、Eu(POS) $_3$ 、Nd(PBS) $_3$ 、Nd(O $_3$ SCF $_3$) $_3$ 、Nd(O $_3$ SC $_6$ F $_1$ 7) $_3$ 、Nd(PMS) $_3$ 、Nd(PES) $_3$ 、Nd(TBS A) $_3$ 、Nd(HBSB) $_3$ 、Eu(TBSA) $_3$ 、文献公知のNd(HFA-H) $_3$ 、Eu(HFA-D) $_3$ 及びNd(HFA-D) $_3$ の各種溶液中での量子収率、発光寿命を表1に示す。溶液の濃度は、0.05モル/リットルである。なお、各錯体の励起波長(nm)及び発光波長(μ m)は、それぞれNd錯体が585nm及び1.06 μ m、Eu錯体が394nm及び0.618 μ mである。検出は、Nd錯体がGeフォトダイオード、Eu錯体がフォトマルチプライヤーを用いて行った。

[0127]

【表1】

錯体	溶媒	量子収率	発光寿命
		(%)	(µs)
Nd (POS):	アセトンーム	3. 2	1 3
Eu (POS),	DMSO-4	56.8	1500
NJ (PBS),	アセトンーム	2. 5	1
Nd (0, SCP ₃),	DMSO-d	3. 4	15.4
Nd (0, SC, F1,)	DMSO-4	4. 1	15.3
Nd (PMS).	DMSO-4	3. 3	-
No (Pes).	DMSO-4	3. 3	-
Nd (TBSA),	DMSO-4	2.8	_
Nd (HBSB),	DMSO-4	3. 3	
En (TBSA),	DMSO-4	7 2	_
nd Offa-H).	アセトンーぬ	0.3	-
Eu (HPA-D) 3	DMSO-d	6 0	_
Nd (HPA-D)	DMSO-de	1. 1	6.3
NT1-2			

以下において、ポリマーの量子収率、発光強度は以下の方法にて評価した、即ち、各ポリマーをフォトマルチプライヤー(Eu錯体の場合)またはGeフォトダイオード(Nd錯体の場合)を用いてスペクトルを測定し、量子収率を得た。また、スペクトルの強度から発光性のないものを"△"、発光するものを"○"、よく発光するものを"◎"、非常によく発光するものを"◎◎"とした。【0128】実施例1

下記式

[0129]

【化15】

$$\mathbb{E}^{n^{2+}}\left\{ \begin{array}{c} C\mathbb{P}^{3} \\ \\ C\mathbb{P}^{3} \end{array} \right.$$

X=H: Eu(HFA-H)₃ X=D: Eu(HFA-D)₃

【0130】で表される公知の希土類錯体Eu(HFA-H)。を 文献 (Hasegawa Y.; Murakoshi K.; Wada, Y.; Yanagid a S.; Kim J.; Nakashima N.; Yamanaka T. Chem. Phy s. Lett. 1996, 248, 8)に記載の方法により製造した。 該錯体Eu (HFA-H)3·2H2O(0.05mmo 1)をDMSO-D₆(66µ1)中に懸濁させ、室温にて2 時間放置した。次いで、精製した無水メチルメタクリレ - h (MMA) (1. Oml), AIBN (0. 5m g)及びEu (HFA-H) 3·2H2O (0.05mm · ol)のDMSO-ds懸濁液をPyrexチューブ (内径4mm、長さ15cm)に移し、脱気後該Pyr exチューブを密閉した。60℃で5時間反応させてM MAの重合を行った。得られたEu (HFA-H) 3及 びDMSO-dsを含むPMMAチューブをPyrex チューブから取り出し、ロッド状のポリマー組成物を得 た。

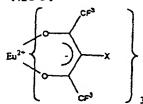
【0131】本ロッド状ポリマー組成物の量子収率及び 発光特性を表2に示す。

【0132】実施例2

下記式

[0133]

【化16】



X=H: Eu(HFA-H)₃ X=D: Eu(HFA-D)₃

【 O 1 3 4 】で表される公知の希土類錯体E u (HFA-H)。を文献(Hasegawa Y.; Murakoshi K.; Wada, Y.; Yanagida S.; Kim J.; Nakashima N.; Yamanaka T. Chem. Phys. Lett. 1996, 248, 8)に記載の方法により製造した。該錯体E u (HFA-H)。 2 H₂OをCD。OD(2 m I)に溶解した。該溶液を脱気した後、減圧

下に6時間CD3OD中で撹拝して、ケトーエノール互変異性による重水器置換反応を行った。減圧下に溶媒を留去し、得られたEu(HFA-D)3・2D1O(0・05mM)をDMSO-d6(66μl)中に懸濁させ、室温にて2時間放置した。次いで、精製した無水メチルメタクリレート(MMA)(1ml)、AIBN(0・5mg)及び希土類錯体のDMSO-d6懸濁液を混合し、Pyrexチューブに移し、脱気後該Pyrexチューブを密閉した。60℃で5時間反応させてMMAの重合を行った。得られたEu(HFA-D)3及びDMSO-d6を含むPMMAチューブをPyrexチューブから取り出し、ロッド状のポリマー組成物を得た

【0135】本ロッド状ポリマー組成物をフォトマルチ プライヤーにより量子収率を測定した。結果を表2に示す。

【0136】さらに、ポリマーの発光強度を表2に示す。

【0137】 実施例3~9

表2に示す錯体、ポリマーマトリックスを用い実施例1 と同様にしてロッド状ポリマー組成物を得た。各々のポ リマーの量子収率及び発光強度を表2に示す。

(0138)なお、実施例3のポリマー組成物の発光スペクトルを図1に、実施例4及び5のポリマーの発光スペクトルを図2に示す。

【0139】比較例1

DMSO-dsを加えない他は実施例4と同様の方法によりロッド状ポリマー組成物を得た。そのものの量子収率及び発光強度を表2に示す。

【0140】実施例4と比較例1を比較すると、実施例4は量子収率が5倍に増加し、また、発光強度も向上しているのがわかる。

【0141】比較例2

DMSO-d₆を加えない他は、実施例2と同様の方法によりロッド状ポリマー組成物を得た。そのものの量子収率及び発光強度を表2に示す。実施例2と比較例2を比較すると、実施例2はDMSO-d₆を加えることにより量子収率が2倍増加し、また、発光強度も向上しているのがわかる。

【0142】 【表2】

<u> </u>	希土類錯体	ポリマー	DMSO-d。 の有無	** リマーの量子 収率 (%)	発光強度
実施例1	Eu (HFA-H) ₃	PMMA	有	11	0
実施例2	Eu(HFA-D) ₃	PMMA	有	44	0
実施例3	Eu(HFA-D) ₃	IFPMA	有	72	00
実施例4	Nd(HFA-D)3	PMMA	有	0.5	0
実施例5	Nd(HFA-D)3	PMMA	有	0.7	0
実施例6	Eu(PMS) ₃	PMMA	有	26	00

実施例7	nd (PMS) 3	PMMA	有	1.3	6
実施例8	Eu(PMS) ₃	PMMA	有	40以上	00
奥施例9	Nd (PMS)3	PMMA	有	1.5	00
比較例1	Nd (HFA-D) 3	PMMA	無	0.1	Δ
比較例2	Eu(HFA-D)'3	PMMA	#	2 1	Δ

奥施例10~21

表3に記載の希土類錯体あるいは希土類錯体のDMSO [(-d。懸濁液を用い実施例1と同様にしてロッド状ポリ [引

マー組成物を得た。発光強度を表3に示す。

[0143]

【表3】

	希土類錯体	ボリマー	DMSO-d6	発光強度
			の有無	
実施例10	Eu(PES) ₃	PHMA	有	00
実施例11	Eu (PES) 3	PMMA	無	0
実施例12	Nd (PES) 3	i FPMA	有	00
実施例13	$Nd(POS)_3$	PMMA	無	00
実施例14	Eu (POS) 3	PMMA	有	© ⊘ ,
実施例15	Tb(POS) ₃	PMMA	有	00
実施例16	$Eu(CF_3SO_3)_3$	PHMA	無	0
実施例17	$Nd(C_8F_{17}SO_3)_3$	PMMA	無	. 0
実施例18	$Nd(PDDD)_3$	PMMA	無	0
実施例19	Nd (TBSA)3	PMMA	無	0
実施例20	Nd (HBSA)3	PHMA	無	0
実施例21	Eu (TBSA) ₃	PMMA		

実施例22

Pyrexチューブ中に、DMSO-d₆(60μ1)で懸濁したEu (HFA-D)₃(190mg)、エポキシ樹脂YD-128(2.5g、「東都化成社製」)、リカシッドMH-700G(2.36g、新日本理化社製)と硬化促進剤TPP-PB(0.04g、北興化学社製)を混合し、150℃で8時間加熱することにより透明のエポキシ樹脂を得た。このポリマーの発光強度を実施例1と同様に評価したところ"○"であった。

【0144】実施例23

 $Eu(HFA-D)_3$ の代わりに $Eu(PMS)_3$ (190 mg)を用いた他は実施例22と同様にポリマーを作成した。このポリマーの発光強度を実施例1と同様に評価したところ"

⋑"	で	あ	7	<i>†</i> .	_
=	•	"	•	•	

【0145】実施例24

DMSO-d_s (60μ1)で懸濁したEu(HFA-D)₃ (40 mg)を5%ナフィオン溶液(2.0ml、「和光純薬社製」)に溶解し、キャスト法により溶媒(水、イソプロパノール)を留去することによりフィルム状のポリマーを得た。このものの発光強度を表4に示す。

【0146】実施例25~28

表3に示す希土類錯体、ポリマー、溶媒を用いた他は実施例24と同様の方法によりフィルム状のポリマーを得た。このものの発光強度を表4に示す。

[0147]

【表4】

	希土類錯体	ポリマー	DMSO	溶媒/m l	発光
			-d ₆		強度
実施例24	Eu (HFA-D) ₃	ナフィオン	有	水/イソプロパノール/5.0ml	00
実施例25	Nd (HBSB)3	ナフィオン	無	水/イソプロパノール/5.0ml	00
実施例26	Eu (PMS) 3	ナフィオン	有	水/イソプロパノール/5.0ml	00
実施例27	Eu (HFA-D) 3	ず リオレフィン*	有	CHC13/4.0ml	0
実施例28	Eu (PMS) 3	<u> </u>	有	CHCl ₃ /4.0ml	0
محبوق فلتساري					

*:ポリエチレンーポリプロピレンラバーEPO2P(日本合成ゴム社製)

実施例29

Pyrexチューブ中に、DMSO-d₆(60μl)で懸濁したEu (HFA-D)₃(40mg)を、ペルフルオロ.4ーメチル-3.6ージオキサクトー7-エンスルホニルフルオリド(0.8ml、「東京化成社製」)、MMA(0.1ml)、iFPrMA(0.1ml)、過酸化ラウロイル(0.5mg、「ナカライテスク社製」)を加え溶解させ、真空

脱気を行い封かんした後、80℃の恒温槽中で5時間加 熱重合反応を行った。その後、チューブ中からロッド状 の半透明ポリマーを取り出した。このポリマーの発光強 度を表5に示す。

【0148】 実施例30~38

表5に示す希土類錯体(40mg)、各記載量のモノマー、重合開始剤0.5mgを用い、実施例29と同様に

ロッド状ポリマーを得た。各々のポリマーの発光強度を 表5に示す。

[0149] 【表5】

	希土類錯体	モノ	7- (n	n 1)	重合	発光強度
		MMA	IFPMA	X1~5	開始剤	
実施例29	Eu (HFA-D) ₃	0.1	0.1	0.8	a.	0
実施例30	Eu (PMS) ₃	0.1	0.1	0.8	a	00
実施例31	Eu (HFA-D) 3	0.1	0.9	_	ь	00
実施例32	Nd (PMS) 3	0.1	0.9	-	ь	00
実施例33	Nd (PES)3	0.1	0.9	-	b	00
実施例34	Nd (HFA-D)3	0.1		0.9	. b	0
実施例35	Eu (PMS) ₃	0.1	-	0.9	ъ	00
実施例36	Eu (HFA-D) 3	0.1	_	0.9	b	00
実施例37	Nd (PBS)3	0.93	-	0.07	ь	©
実施例38	Nd (HBSB)3	0.6		0.4	ь	0
表5中.						

X1: ペルフルオロ, 4-メチル-3, 6-ジオキサクト-7-エンスルネニルフルオリド(東京化成社製;実施例29)

X²: ^ h7h107 04 19t 二h1-7h(東京化成社製: 実施例30)

X3:7/1/A酸(1/7/4107) ot / AIAF/A(東京化成社製: 実施例34)

. X1:nFPMA(実施例35、36)

X5: スチレン(実施例37、38)

重合開始剤 a:過酸化ラウロイル

b:AIBN

本発明の好ましい態様としては、以下のものが例示され

【0150】項A. Rfi、Rfi、Rfi、Rfi、Rfiが水素 原子を含まないC1~C12の脂肪族基である項1に記載 の組成物。

【O 1 5 1】項B、 Rfi、Rfi、Rfi、Rfi、RfiがCi~。 C22のパーフルオロアルキル基又はC1~C22のパーク ロロアルキル基である項1に記載の組成物。

【0152】項C. Rfi、Rfi、Rfi、Rfi、RfiがC1~ C10のパーフルオロアルキルまたはC1~C10のパーク ロロアルキルである項1に記載の組成物。

【O153】項D、 Rfl、Rfl、Rfl、Rfl、Rflが二ト ロ基、C₁~C₄のパーハロゲン化アルキル基(トリフル オロメチル等)、C1~C4のパーハロゲン化アルコキシ 基(トリフルオロメトキシ等)、C,~C,のパーハロゲ ン化アルキルカルボニル基(トリフルオロアセチル 等)、C₁~C₁のパーハロゲン化アルキレンジオキシ基 (ジフルオロメチレンジオキシ等)、C,~Csのパーハ ロゲン化アルケニル基 (パーハロゲン化ビニル等)、パ ーハロゲン化フェノキシ基、C2~C20パーハロゲン化 アルキルカルボニルオキシからなる群から選ばれる1又 は2の遺換基で置換されていてもよいパーハロゲン化芳 香族基である項A~項Cのいずれかに記載の組成物。

【O154】項E、 Rfi、Rfi、Rfi、Rfi、Rfiが二ト ロ基、C₁~C₄のパーハロゲン化アルキル基(トリフル オロメチル等)、C₁~C₁のパーハロゲン化アルコキシ 基(トリフルオロメトキシ等)、C2~C5のパーハロゲ ン化アルキルカルボニル基(トリフルオロアセチル

等)、C₁~C₄のパーハロゲン化アルキレンジオキシ基 (ジフルオロメチレンジオキシ等)、C,~C。のパーハ ロゲン化アルケニル基(パーハロゲン化ビニル等)、パ ーハロゲン化フェノキシ基、Cz~Czoパーハロゲン化 アルキルカルボニルオキシからなる群から選ばれる1又 は2の置換基で置換されていてもよいパーハロゲン化フ ェニル基である項A~項Cのいずれかに記載の組成物。 【0155】項F. 2、が重水素、ハロゲン原子、C

1~C22のパーフルオロ化アルキル基またはC1~C22の パーフルオロアルケニル基である項A~項Eのいずれか に記載の組成物。

【0156】項G. Z'が重水器、ハロゲン原子、C 1~C,のパーフルオロ化アルキル基またはC1~C,のパ ーフルオロアルケニル基である項Fに記載の組成物。

【0157】項H. 2、が重水衆又はハロゲン原子で ある項Gに記載の組成物。

【0158】項I、 MがLa、Ce、Pr、Nd、P m, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, T m、Yb、Luからなる群から選ばれる少なくとも1種 である項1に記載の組成物。

【0159】項J. MがNd、Eu、TbおよびYb からなる群から選ばれる少なくとも1種である項 I に記 戯の組成物。

【0160】項K、 Rf1、Rf2、Rf3、Rf4、Rf5が任意 の位置のC-C単結合の間に-O-、-COO-、-O CO-、-CO-を1個または複数個介在させて、エー テル、エステルまたはケトン構造としたパーハロゲン化 アルキル基またはパーハロゲン化アルケニル基である項 1に記載の組成物。

【0161】項L. Rfl、Rfl、Rfl、Rfl、Rflがパーフルオロアルキル基またはパーフルオロアルケニル基である項1に記載の組成物。

【0162】項M. X¹及びX²がS、 n_3 が1; X¹が S、X²がC、 n_3 が1;或いは、X¹及びX²がC、 n_3 が1である項1に記載の組成物、

【0163】項N. MがNd、Yb、TbまたはEuである、項1に記載の組成物。

【0164】項O. YがC-D、C-C1、C-F、C-Br、C-I、NまたはPである、項1に記載の組成物。

【0165】・ Rf^1 が C_1 ~ C_{12} のパーハロゲン化脂肪族基を示し、 Rf^1 がパーハロゲン化芳香族基を示し、 Z^1 は重水素、ハロゲン原子、 C_1 ~ C_{22} のパーハロゲン化脂肪族基を示し、Mはしa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm 、Y b、Luからなる群から選ばれる少なくとも1種を示し、 n_1 は2または3を示し、 n_2 は2、3又は4を示す組成物、

・Rflが $C_1 \sim C_{22}$ のパーハロゲン化脂肪族基を示し、Rf 2 がパーハロゲン化芳香族基を示し、 2^+ が重水素、ハロゲン原子、 $C_1 \sim C_1$ のパーフルオロ化アルキル基またはパーフルオロアルケニル基を示し、MはNd、EuおよびYbからなる群から選ばれる少なくとも1種を示し、 n_1 は2または3を示し、 n_2 は3を示す組成物。

【0166】・ Rf^1 が C_1 ~ C_{22} のパーハロゲン化脂肪族基を示し、 Rf^2 がパーハロゲン化芳香族基を示し、Z'が重水素又はハロゲン原子を示し、MはNdを示し、 n_1 は3を示し、 n_2 は3を示す組成物。

【0168】・ Rf^1 が $C_1 \sim C_{22}$ のパーフルオロ脂肪族基かつ Rf^2 がパーフルオロ芳香族基; Rf^1 が $C_1 \sim C_{22}$ のパーフルオロ脂肪族基かつ Rf^2 がパークロロ芳香族基; Rf^1 が $C_1 \sim C_{22}$ のパークロロ脂肪族基かつ Rf^2 がパーフルオ

ロ芳香族基;またはRflがC₁~C₁₂のパークロロ脂肪族 基かつRflがパークロロ芳香族基を示し、Z¹が重水 索、ハロゲン原子、C₁~C₁のパーフルオロ化アルキル 基またはパーフルオロアルケニル基を示し、MはNd、 EuおよびYbからなる群から選ばれる少なくとも1種 を示し、n₁は2または3を示し、n₂は3を示す組成 物。

【0169】・Rf が $C_1 \sim C_{20}$ のパーフルオロ脂肪族基かつRf が $C_1 \sim C_{22}$ のパーフルオロ脂肪族基かっRf が $C_1 \sim C_{22}$ のパーフルオロ脂肪族基かっRf がパークロロ芳香族基;Rf が $C_1 \sim C_{22}$ のパークロロ脂肪族基かのRf がパーフルオロ芳香族基;Rf がRf がパークロロ脂肪族基かっRf がパークロロ芳香族基を示し、Rf がRf がパークロロ芳香族基を示し、Rf がRf かRf がRf がRf

【0170】・ Rf^1 が C_6 ~ C_{10} のパーフルオロアルキルまたは C_6 ~ C_{10} のパークロロアルキルを示し、 Rf^2 がペンタフルオロフェニル、ペンタクロロフェニルまたはその誘導体を示し、 Z^* が重水素、ハロゲン原子、 C_1 ~ C_4 のパーフルオロ化アルキル基またはパーフルオロアルケニル基を示し、MはLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb 、Dy 、Ho 、Er 、Tm 、Yb 、Lu からなる群から選ばれる少なくとも1種を示し、 n_1 は2または3を示し、 n_2 は2、3又は4を示す組成物。

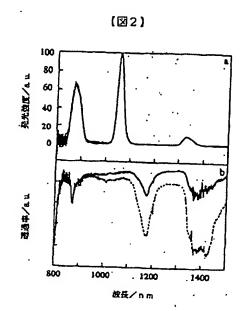
【0171】・ Rf^I が $C_5 \sim C_{10}$ のパーフルオロアルキルまたは $C_5 \sim C_{10}$ のパークロロアルキルを示し、 Rf^I がペンタフルオロフェニル、ペンタクロロフェニルまたはその誘導体を示し、2 が重水繁、ハロゲン原子、 $C_1 \sim C_4$ のパーフルオロ化アルキル基を示し、MはN d、E uおよびY bからなる群から選ばれる少なくとも 1 程を示し、 n_1 は2または3を示し、 n_2 は3を示す組成物。【0172】・ Rf^I が $C_5 \sim C_{10}$ のパーフルオロアルキルまたは $C_6 \sim C_{10}$ のパークロロアルキルを示し、 Rf^I がペンタフルオロフェニル、ペンタクロロフェニルまたはその誘導体を示し、Z が重水衆又はハロゲン原子を示し、MはN dを示し、 n_1 は3を示し、 n_2 は3を示す組成物。

【図面の簡単な説明】

【図1】Eu (HFA-D)₃+DMSO-d₆のiFP MA中での発光スペクトルを示す。

【図2】Nd (HFA-D)₃+DMSO-d₆のPMM A中での発光スペクトル (点線) 及びNd (HFA-D)₃+DMSO-d₆の $_1$ FPMA中での発光スペクトル (実線)を示す。

(図1) 免れ始度/3.4 . 700 800 900 被选/nm



フロントページの続き

(51) Int. Cl.7

識別記号

CO8L 63/00

C09K 11/06

(72)発明者 和田 雄二

大阪府豊中市西緑丘2-2-3豊中東合同

宿舍344

FΙ

CO8L 63/00

CO9K 11/06

(72)発明者 柳田 祥三

兵庫県川西市鴬台2-10-13

Fターム(参考) 4J002 BB031 BB121 BB171 BC021

BE041 BG031 BG061 BG081

. CD001 EP017 EV207 EZ006

デーマコート (参考)